Nano-size BaTiO3의 소결 Sintering of Nano-size BaTiO3

<u>김현태</u>, 한영호 성균관대학교 재료공학과

본 연구에서는 two step sintering process를 이용하여 nano-size의 grain을 갖는 BaTiO₃를 제조하였다 Nano size BaTiO₃ powder는 pechini process를 이용해 합성하였고, 입자의 크기는 17 nm정도였다. 일반적인 one step sintering process의 경우 (1200℃까지 3℃/min으로 올린 후 1~5시간 유지) 소결 유지 시간이 증가함에 따라 grain이 성장하여 5시간 유지 시 8~10 μm까지 성장함을 관찰 할 수 있었다 반면 two step sintering process의 경우 (1300℃까지 10℃/min으로 올린 후 바로 냉각하여 1100℃에서 0~20시간 유지), grain size는 1 μm 이하의 크기를 보였고, 이때 밀도는 이론 밀도의 95%를 나타내었다 Grain growth inhibitor로 알려진 Ca를 첨가하여 동일한 조건 하에 two step sintering을 한 경우 400~500 nm의 grain size를 갖는 소결체를 제작할 수 있었다

A-8

Sol-gel 법으로 제조된 강유전체 Sro 9Bi2 1Ta1 8Nb0 2O9 박막의 저온결정화 공정

Low Temperature Crystallization Process of Sol-gel Derived Ferroelectric Sr_{0.9}Bi_{2.1}Ta_{1.8}Nb_{0.2}O₉ Thin Films

> <u>조태진</u>, 김영준, 강동균, 김병호 고려대학교 재료공학과

SBTN solution with $Sr_{0.9}B_{12.1}Ta_{1.8}Nb_{0.2}O_{9}$ composition was synthesized by sol-gel method $Sr(OC_{2}H_{5})_{2}$, $B_{1}(TMHD)_{3}$, $Ta(OC_{2}H_{5})_{5}$, and $Nb(OC_{2}H_{5})_{5}$ were used as precursors, which were dissolved in 2-methoxyethanol SBTN thin films with 200 nm thickness were deposited on $Pt/T_{1}O_{2}/S_{1}O_{2}/S_{1}$ substrates by spin-coating UV-irradiation in a power of 200 W for 10 min and RTA (Rapid Thermal Annealing) in an oxygen ambient at 760°C for 60 sec were used to promote crystallization. Thin films were furnace-annealed in an oxygen ambient at 650°C for 1 h. Pt top electrode was deposited by sputtering and the thin films were post-annealed to measure their structural and dielectric/electrical properties.